



# 특허등록원부

특 허 번 호 제 2272808 호

## [ 권 리 란 ]

표시번호	등 록 사 항			
1번	출원연월일	2019년 11월 22일	출원번호	2019-0151284
	특허결정(심결)연월일	2021년 06월 28일	청구범위의 항수	12
	분류기호	H01L 21/304, H01L 21/3105, H01L 21/02, H01L 21/67, H01L 21/687		
	발명의 명칭	평탄화 장치 및 이를 포함하는 기판 처리 장치, 기판 처리 방법		
	존속기간(예정)만료일	2039년 11월 22일		
2021년 06월 29일 등록				

## [ 특 허 료 란 ]

제 01 - 03 년분 (2021.06.29 ~ 2024.06.29) 금 액 246,500 원(전담조직) 2021년 06월 29일 납입

## [ 특 허 권 자 란 ]

(최종권리자) 세종대학교산학협력단 (240171-*****) 서울특별시 광진구 능동로 209 (군자동, 세종대학교)	
순위번호	등 록 사 항
1번 (등록권리자)	세종대학교산학협력단(240171-*****) 서울특별시 광진구 능동로 209 (군자동, 세종대학교)
2021년 06월 29일 등록	

이 등본(초본)은 등록원부와 틀림이 없음을 증명합니다.  
( 제 000209169 호 )

2021년 07월 01일

특 허 청 장



1

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)의 '특허넷-온라인제증명발급' 메뉴를 통해 발급번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 단, 발급번호를 통한 확인은 90일까지 가능합니다.

